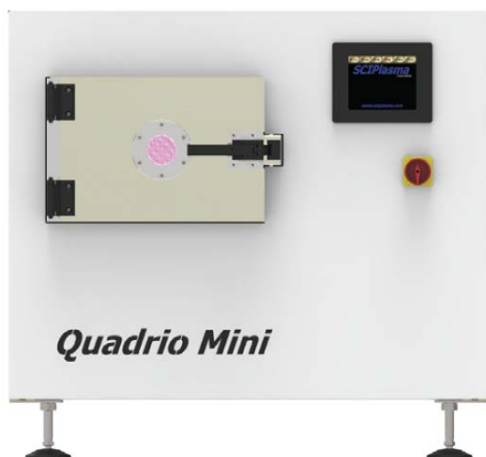


Система плазменной очистки Quadrio Mini

Система плазменной очистки Quadrio Mini – это компактная камерная система настольного типа для очистки и модификации поверхностей различных материалов. Система предназначена для применения в лабораторных условиях или в мелкосерийном производстве.

Основные преимущества:

- Автоматический или ручной режим управления с помощью ПЛК, сенсорный дисплей
- Цифровой контроллер массового расхода газа для газовой линии
- Высокоточный емкостной датчик давления
- Алюминиевая рабочая камера, покрытая никелем
- Система подготовлена для использования в чистых комнатах
- Соответствует европейским и международным стандартам CE & ISO 9001, S2/S8



Основные применения:

- Очистка выводных рамок перед разваркой проволоочных соединений
- Очистка поверхностей от органических загрязнителей (например, перед разваркой проволоочных соединений)
- Улучшение адгезионных свойств поверхностей перед заливкой компаундом
- Удаление флюса с поверхности полупроводниковых корпусов или гибридных сборок
- Общая активация и очистка поверхности полупроводниковых пластин, маленьких объектов, полиимидных гибких подложек
- Повышение адгезии флип-чип сборок перед заливкой
- Применения в солнечной энергетике

Спецификация:

Камерная система плазменной обработки поверхности Quadrio Mini	
Материал рабочей камеры	Никелированный алюминий
Размеры/объем рабочей камеры	300 x 180 x 200 (В) мм/ 10.8 л
RF генератор плазмы	13.56 МГц, 200 Вт
Конфигурация электрода	Планарная
Датчик давления (1 шт), диапазон измерений	От 1 до 1×10^{-3} мбар
Возможные рабочие газы	Ar, O ₂ , N ₂ , He, Ar/O ₂ , Ar/H ₂ , другие – по требованию Заказчика
Количество газовых линий с цифровыми контроллерами расхода	1 шт
Вакуумный насос	Масляный насос, скорость откачки 5 м ³ /час
Управление	ПЛК, сенсорный экран 7.5"
Программное обеспечение	Полностью автоматизированный или ручной режимы управления, возможность сохранения всех параметров процесса на карте памяти, защищенный доступ, возможность настройки различных сигналов оповещения для более детального контроля процесса
Питание	Одна фаза, 100-240 В, 50/60 Гц, 2.0 кВт*А
Макс. давление рабочего газа	1.5 бар
Требуемая чистота рабочего газа	99.995 или выше
Давление подключаемого сжатого воздуха	4-6 бар
Габаритные размеры	804 x 832 x 751.5 мм (ДхГхВ)
Вес	200 кг

Доступные опции:

- Различная конфигурация электродов
- Различные размеры рабочей камеры
- Водородный генератор
- Линия продувки азотом
- Дополнительная газовая линия с цифровым контроллером расхода газа

